

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第4区分

【発行日】平成22年11月4日(2010.11.4)

【公開番号】特開2009-155726(P2009-155726A)

【公開日】平成21年7月16日(2009.7.16)

【年通号数】公開・登録公報2009-028

【出願番号】特願2008-292174(P2008-292174)

【国際特許分類】

C 25 D 21/10 (2006.01)

C 25 D 21/00 (2006.01)

C 25 D 7/12 (2006.01)

C 25 D 5/08 (2006.01)

C 25 D 17/10 (2006.01)

H 01 L 21/60 (2006.01)

【F I】

C 25 D 21/10 3 0 1

C 25 D 21/00 E

C 25 D 7/12

C 25 D 5/08

C 25 D 17/10 A

H 01 L 21/92 6 0 4 B

【手続補正書】

【提出日】平成22年9月14日(2010.9.14)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0094

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0094】

このように、調整板移動機構142を介して、調整板134の基板Wに対する水平方向の位置を微調整したり、調整板移動機構160を介して、調整板134の基板Wに対する水平及び垂直方向の位置を微調整したりすることで、基板Wの表面に形成されるめっき膜の膜厚の面内均一性を向上させることができる。特に、調整板134は、基板Wに近接した位置に配置されるため、調整板134の基板Wに対する垂直または水平方向の位置を微調整することが、基板Wの表面に形成されるめっき膜の膜厚の面内均一性を向上させる上で重要となる。